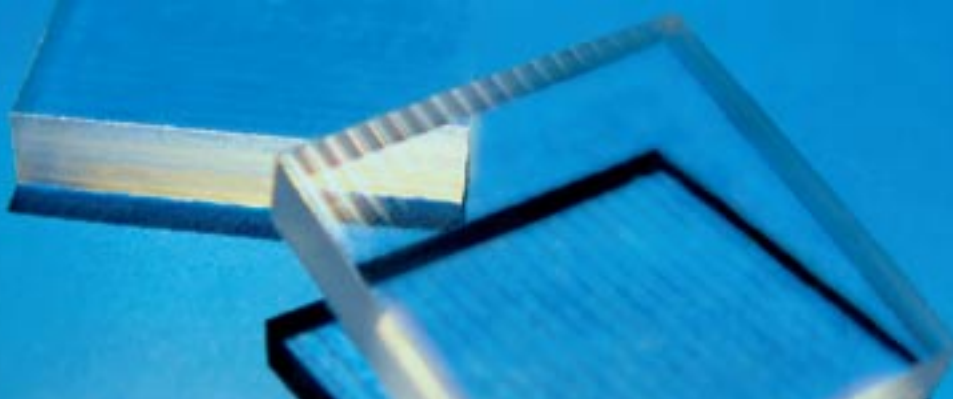




CaF₂マイクロレンズ・アレイによるUVビーム・シェーピング



UVレーザービームの均質化は困難といわれています。しかし、色々なアプリケーション分野で、高い出力密度で任意の強度分布を持つビームから、滑らかなビームプロファイルを生成する必要性が生じています。特に工業用途に於けるエキシマレーザーや、LD励起のTHGレーザー等、高パルスエネルギーを有するUVレーザーには、CaF₂のマイクロレンズアレイが最も適しており、均質な強度分布を生成する事が可能で、しかも高い耐久性を持っています。イエナオプティックCaF₂マイクロレンズ・アレイは、高効率・長寿命で殆どあらゆるビームプロファイルから、カスタムのトップハット・ファーフィールド・

特長

- ・優れた DUV 透過性
- ・石英より、DUV に対する耐性が高い
- ・カスタム設計が可能
- ・高効率
- ・エッジの鋭いトップハットプロファイル
- ・低変調
- ・入射ビーム形状にあまり依存しない

アプリケーション

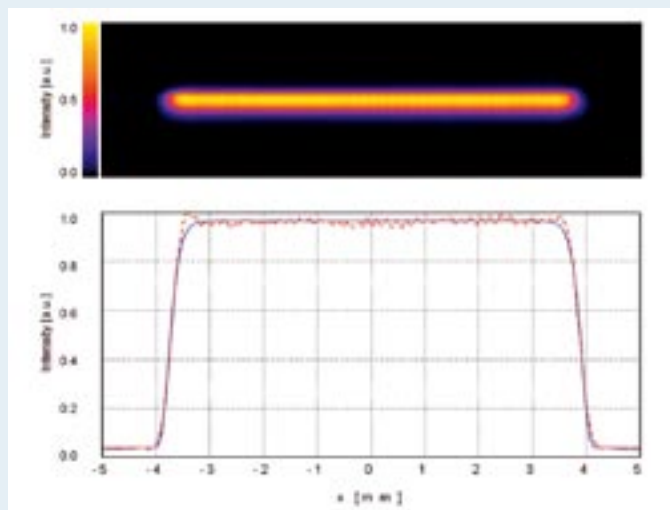
- ・プロ半導体産業向け照明システム
- ・眼科
- ・レーザー物質加工
- ・印刷技術
- ・測定システム

CaF₂マイクロレンズ・アレイによるUVビーム・シェーピング

仕様

均一性 :	< 7 %
効率 :	> 92 % (ARコート付きの場合)
最大レンズサイズ :	2 μm
開口径 :	5 mm ~ 120 mm
レーザー波長 :	> 157 nm
材質 :	CaF ₂
ARコート :	オプション
製品ナンバー	029143

CaF₂マイクロレンズ・アレイによる193nmレーザー光均一化の標準結果



配置 :

両面マイクロ結像レンズ構成

入射レーザービームサイズ (1/e²) : 3 mm × 6 mm

レーザービーム開き角 : 2 × 1 mrad

CaF₂マイクロレンズ・アレイ

レンズピッチ : 0.5 mm

焦点距離 : 30 mm

結果 :

均一性 : < 6.3 %

効率 : > 92.2 %

出力レーザービームサイズ (1/e²) : 0.54 mm × 7.8 mm

※仕様は予告なく変更することがあります。(2011年9月現在)